

# ナノプロセッシング施設オンラインセミナー マスクレス描画技術

産業技術総合研究所TIA推進センター ナノプロセッシング施設(NPF)は、電子ビーム、及びレーザービームを用いたマスクレス描画に関わる技術セミナーを、オンラインにて2022年3月11日(金)に開催します。前半はシリコン量子ビット作製に向けた極微細電子ビーム露光技術と電子ビーム描画装置の高速化について、後半はレーザー描画装置によるグレースケール露光や厚膜レジストプロセスについて紹介いたします。産学官いずれのご所属の方にも奮ってのご参加をお待ちしています。

また、本セミナーでは2022年度からのご利用が可能になるハイデルベルグ・インストルメンツ社製のDWLレーザー描画装置を使ったリソグラフィ実習コースをご用意しました。座学コースへの参加が条件となりますが、こちらについても参加をお待ちしています。

**【日時】** 2022年3月11日(金) 12:55~17:10

**【オンライン】** 会議招待メールを後日参加申し込みされた方にお送りします。

**【参加費】** 無料

**【定員】** 150名(先着順、参加登録をお願いします)

**【セミナー案内/申し込み】** <https://www.tia-kyoyo.jp/npf/seminar/2021-2/>

## 【講演プログラム】

- 12:55-13:00 はじめに 産業技術総合研究所 多田哲也
- 13:00-13:40 『シリコン量子ビット作製と大規模集積化に向けた電子線リソグラフィ技術』  
産業技術総合研究所 先端CMOS技術研究グループ 加藤公彦
- 13:40-14:10 『大面積偏向を有する超高速電子ビーム加工装置(UHSEB)の応用展開に向けた試作研究』  
産業技術総合研究所 集積化MEMS研究グループ 尹成圓
- 14:10-14:40 『電子ビーム描画装置(ELS-BODEN)による高スループット描画』  
GenISys株式会社 清水 諭
- 14:40-15:00 休憩
- 15:00-15:40 『レーザー描画に適した厚膜レジストと微細電子ビーム描画用レジストの紹介』  
株式会社日本レーザー 鶴田逸人
- 15:40-16:10 『ハイデルベルグ・インストルメンツ DWLシリーズによるグレースケール露光』  
ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社 上瀧英郎
- 16:10-16:40 『レーザー直接描画装置を利用したグレースケール露光と補正技術について』  
Bush Clover 株式会社 新関 嵩
- 16:40-17:10 『レーザーグレースケール露光及びバイナリ露光のための描画データ最適化』  
GenISys株式会社 清水 諭

## 【リソグラフィ実習コース】

日時: 2022年4月21日(木)、22日(金) (2日間)

場所: 産業技術総合研究所つくば中央2-12棟 ナノプロセッシング施設

参加費: 無料

定員: 3名

## 【実習の概要】

ハイデルベルグ・インストルメンツ社製レーザー描画装置DWL 66+を使ったマスクレスでのバイナリ及びグレースケール露光とGenISys社製BEAMERを使ったデータ補正技術を実際にご覧頂きます。

主催: 産業技術総合研究所TIA推進センターナノプロセッシング施設(NPF)

共催: ナノエレクトロニクス計測分析技術研究会(TSC)

電子メール: [tia-npf-school2@aist.go.jp](mailto:tia-npf-school2@aist.go.jp)

